

ISSN 1813-8586

# НАНО-И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА



- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

Том 18. № 1. 2016



**Уважаемые читатели и авторы!  
Редколлегия и редакция  
журнала поздравляет вас  
с Новым годом!**

В 2015 г. Министерство образования и науки РФ включило журнал «Нано- и микросистемная техника» (НМСТ) в обновленный Перечень рецензируемых ведущих научных рейтинговых отечественных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Прежде всего в издательстве «Новые технологии» было решено, что журнал НМСТ должен соответствовать требованиям, предъявляемым международной реферативной базой данных Scopus, которые были реализованы с первых номеров 2014 г.

С 2016 г. избранные статьи авторов журнала НМСТ будут опубликованы в дополнительном номере журнала Russian Microelectronics, издаваемого на английском языке и включённого в глобальный индекс цитирования Scopus.

Журнал НМСТ включен в Российский индекс научного цитирования.

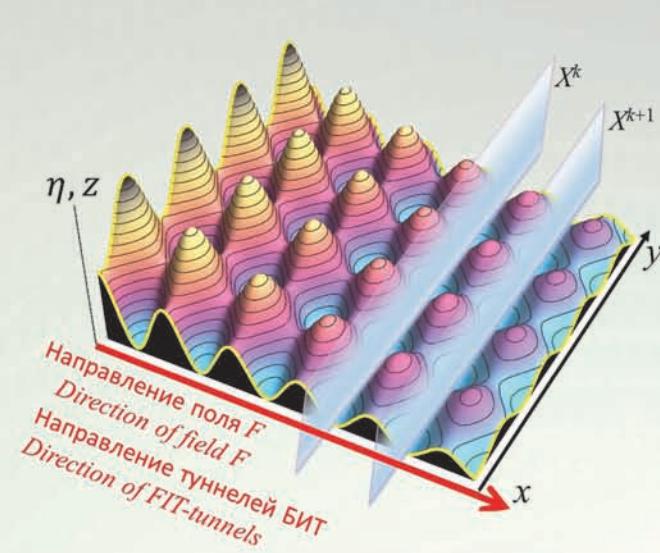
Кроме того, журнал НМСТ включен в международные базы данных технической литературы на английском языке INSPEC, базу данных CAS и базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

В 2015 г. журнал НМСТ сделал новый шаг к международной доступности и стал публиковать перевод статей на английском языке.

Уточненные рекомендации авторам по подготовке рукописей статей для печати ежегодно публикуются в журнале и приведены на сайте журнала: <http://www.microsystems.ru>

Надеемся в новом году на увеличение числа публикаций от авторов не только из различных регионов России, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Главный редактор  
Петр Мальцев



Рисунки к статье  
А. Л. Деспотули, А. В. Андреевой  
**«ЭФФЕКТИВНОЕ  
В СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОМ  
ПОДХОДЕ НАНОИОНИКИ»**

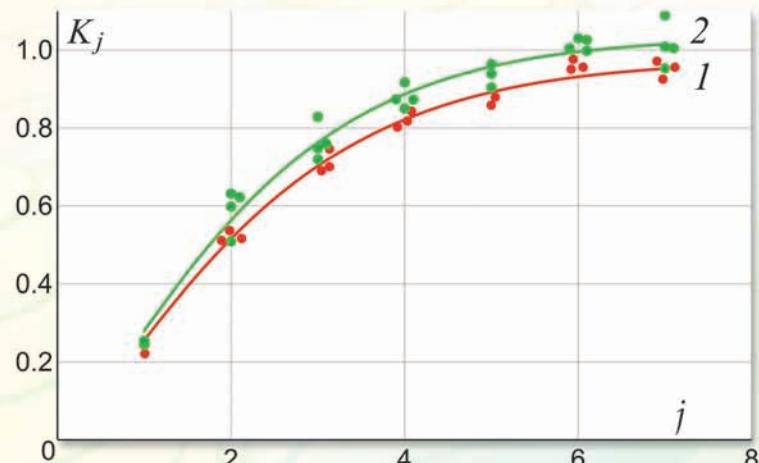
A. L. Despotuli, A. V. Andreeva  
**«EFFECTIVE ELECTROSTATIC FIELD IN  
THE STRUCTURE-DYNAMIC APPROACH  
IN NANOIONICS»**

**Рис. 2.** Область неоднородного на наномасштабе потенциального рельефа в модельнойnanoструктуре на основе ТЭ. Показаны две смежные плоскости ( $X^k$  и  $X^{k+1}$ ) из семейства параллельных плоскостей  $\{X^j\}$ . Координатная ось  $x$  совпадает с направлением транспорта ионов подвижного сорта по туннелям БИТ, а также с направлением электрического поля  $F$

*Fig. 2. The region of a non-uniform on nanoscale potential landscape in the model SE nanostructure. Two adjacent planes ( $X^k$  and  $X^{k+1}$ ) from family of the parallel crystallographic planes  $\{X^j\}$  are shown. The axis  $x$  coincides with the direction of mobile ion transport in the FIT-tunnels, and with the direction of electric field  $F$*

**Рис. 3.** Зависимость коэффициента  $K_j$  от индекса плоскости  $j$  для  $\epsilon = 50$  и  $\lambda_Q = 0,3$  нм (график 1) и  $\lambda_Q = 0,4$  нм (график 2)

*Fig. 3. The dependence of corrective coefficients  $K_j$  on plane index  $j$  for  $\epsilon = 50$  and  $\lambda_Q = 0.3$  nm (graph 1) and  $\lambda_Q = 0.4$  nm (graph 2)*



**Рис. 4.** Зависимость коэффициентов  $K_{1,2}$  и  $K_{1,3}$  от отношений  $\delta^i / \delta^2$  и  $\delta^i / \delta^3$ :  
1 –  $K_{1,2}$  при  $\lambda_Q = 0,3$  нм; 2 –  $K_{1,2}$  при  $\lambda_Q = 0,4$  нм; 3 –  $K_{1,3}$  при  $\lambda_Q = 0,3$  нм;  
4 –  $K_{1,3}$  при  $\lambda_Q = 0,4$  нм

*Fig. 4. Dependence of coefficients  $K_{1,2}$  and  $K_{1,3}$  on relations  $\delta_1 / \delta_2$  and  $\delta_1 / \delta_3$ :  
1 is  $K_{1,2}$  at  $\lambda_Q = 0.3$  nm; 2 is  $K_{1,2}$  at  $\lambda_Q = 0.4$  nm; 3 is  $K_{1,3}$  at  $\lambda_Q = 0.3$  nm; 4 is  $K_{1,3}$  at  $\lambda_Q = 0.4$  nm*

